



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D237229 S

(45)公告日：中華民國 114 (2025) 年 04 月 01 日

(21)申請案號：112302648D02

(22)申請日：中華民國 112 (2023) 年 06 月 16 日

(51)LOC.(13)Cl.：15-99

(30)優先權：2022/12/16 美國

29/863,220

(71)申請人：美商應用材料股份有限公司 (美國) APPLIED MATERIALS, INC. (US)
美國(72)設計人：萊克 馬丁李 RIKER, MARTIN LEE (US)；法凱 路克菲安妮 VARKEY, LUKE
VIANNEY (IN)；謝 祥金 XIE, XIANGJIN (US)

(74)代理人：李世章；彭國洋

(56)參考文獻：

TW D200242

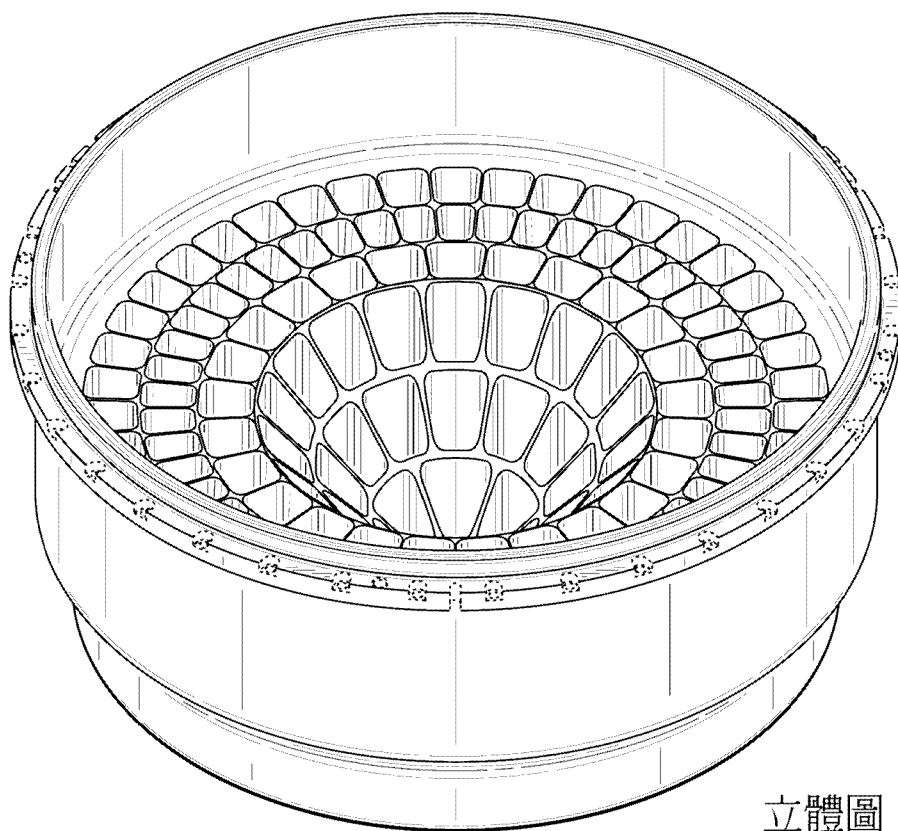
審查人員：朱哲慶

圖式數：9 共 10 頁

(54)名稱

用於物理氣相沉積 (PVD) 腔室的準直器

代表圖：



立體圖



D237229

【衍生設計說明書】

【中文設計名稱】用於物理氣相沉積（PVD）腔室的準直器

【英文設計名稱】COLLIMATOR FOR USE IN A PHYSICAL VAPOR
DEPOSITION (PVD) CHAMBER

【物品用途】

【0001】 本衍生設計所請求係用於物理氣相沉積（PVD）腔室的準直器。

【設計說明】

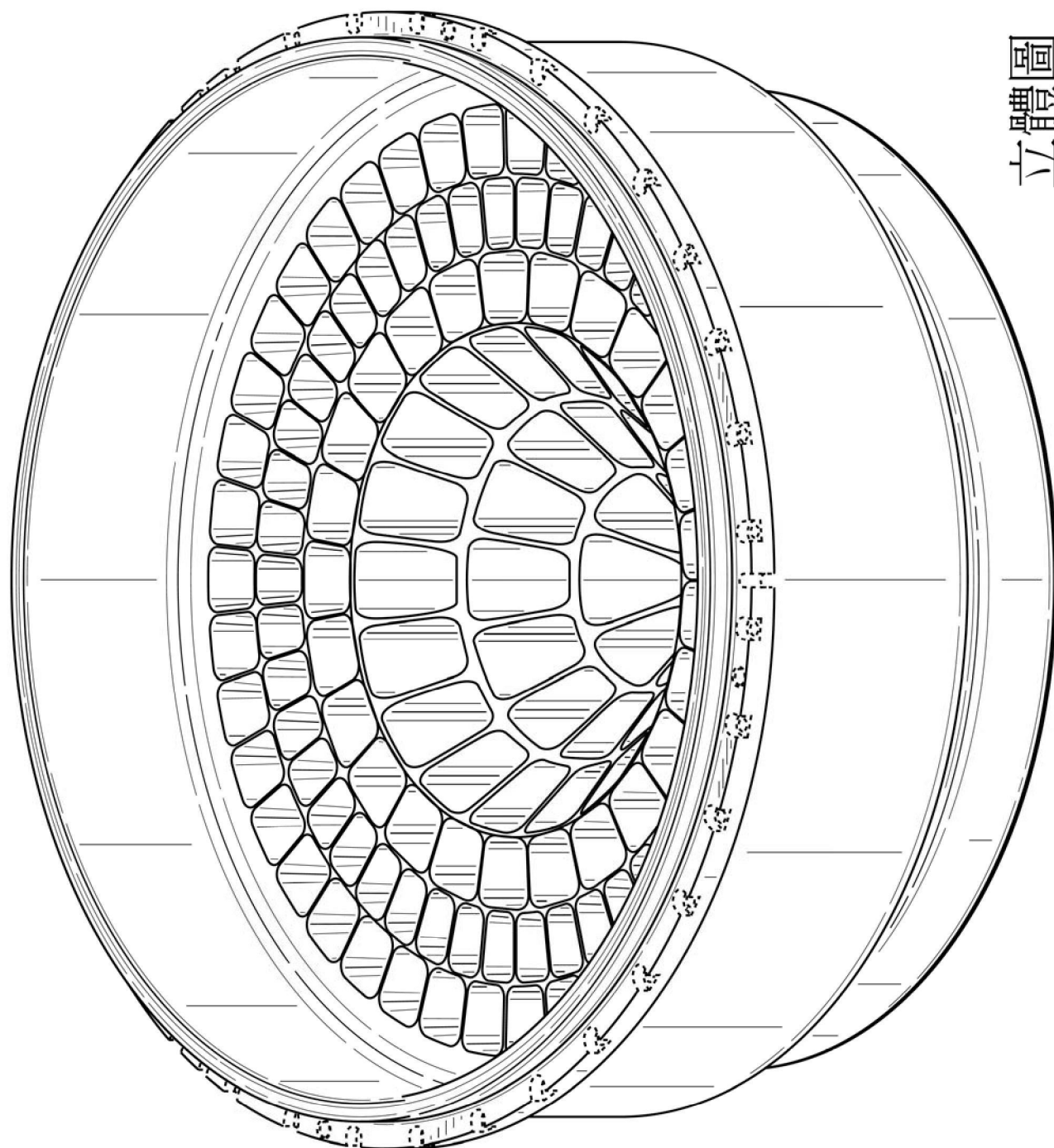
【0001】 本衍生設計與原設計（第112302648號申請案）的差異在於：本設計的外部三列通道中的中間列中的各通道的寬度小於其他兩列通道中的各通道的寬度；相對地，在原設計中，以垂直俯視視角觀察，原設計的外部三列通道中的各列通道的寬度則是實質上相同的。

【0002】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

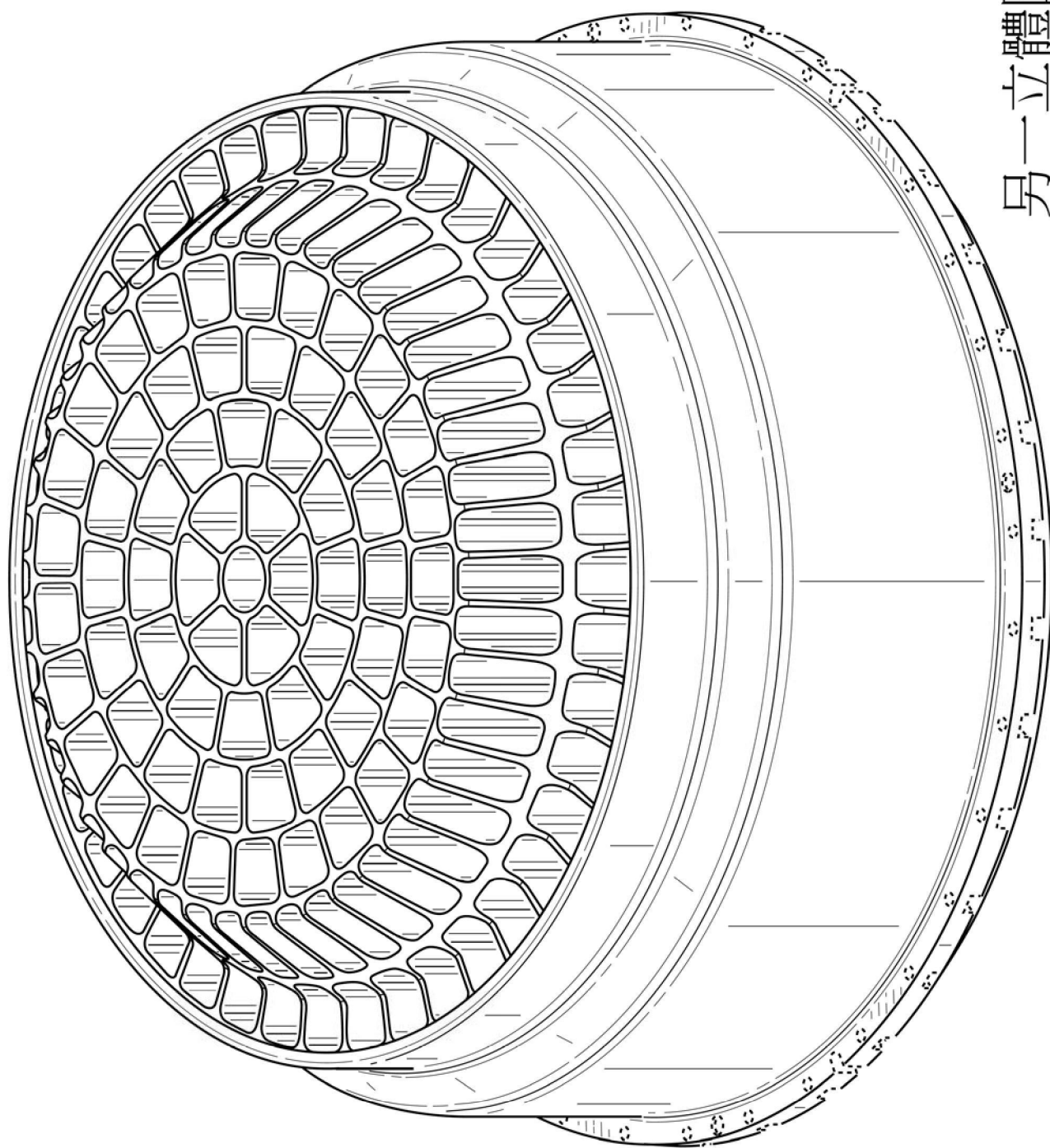
【衍生設計圖式】

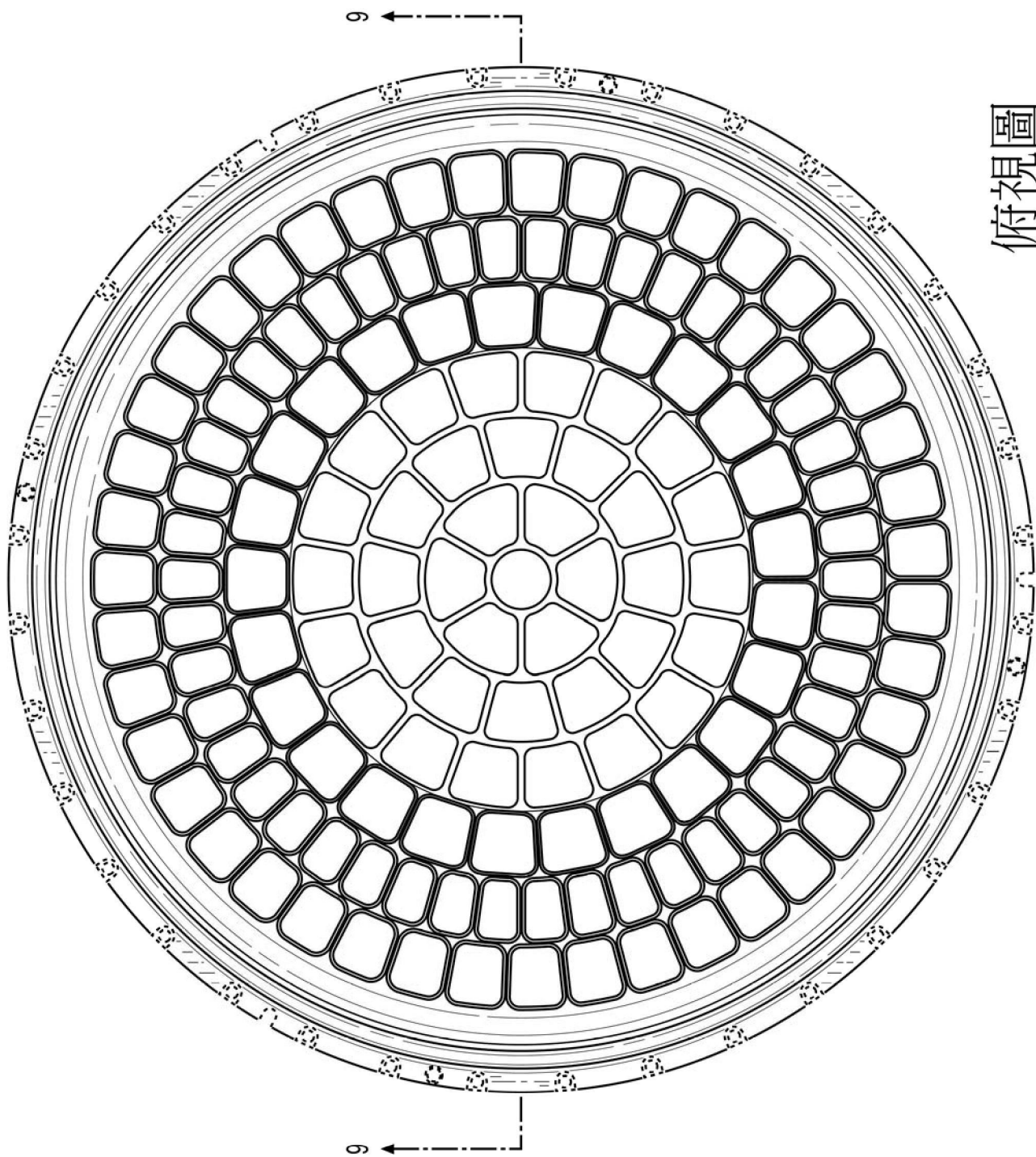
(指定代表圖)

圖
體
立



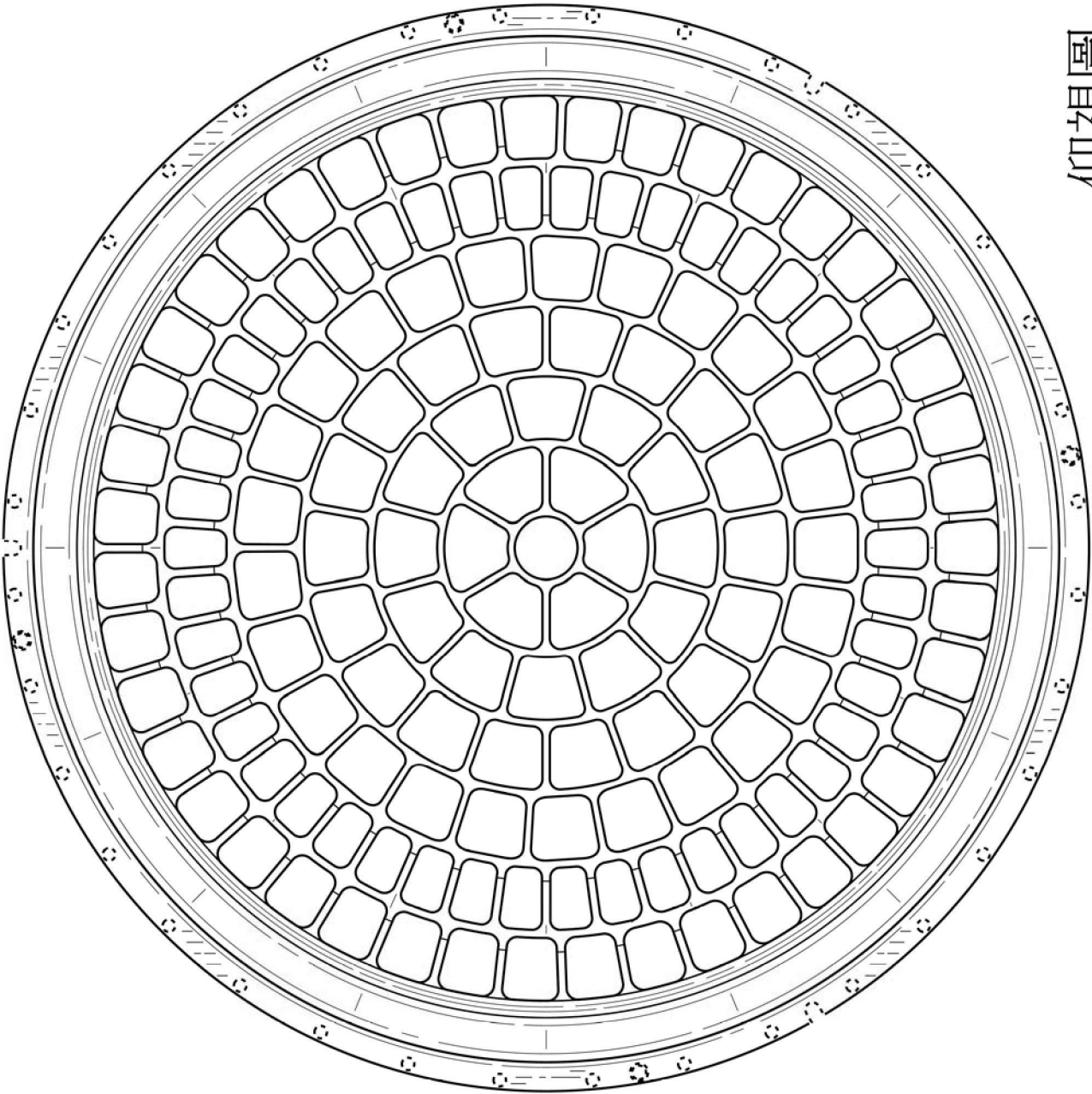
另一立體圖

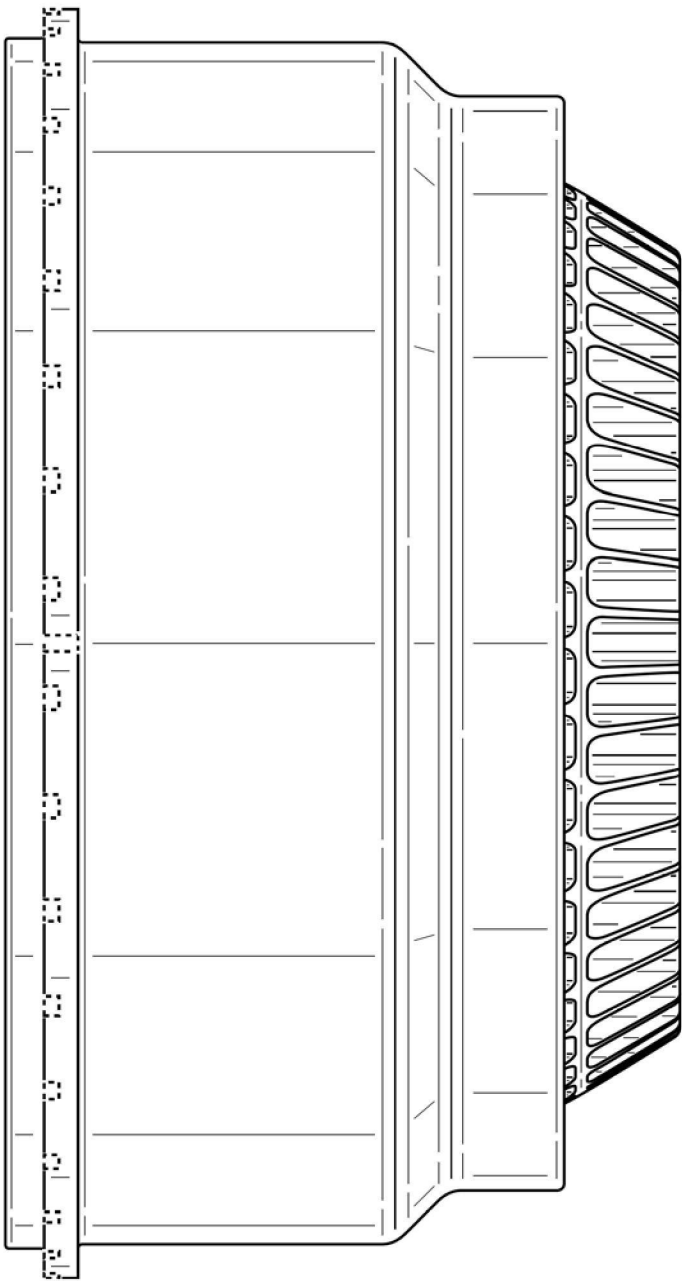




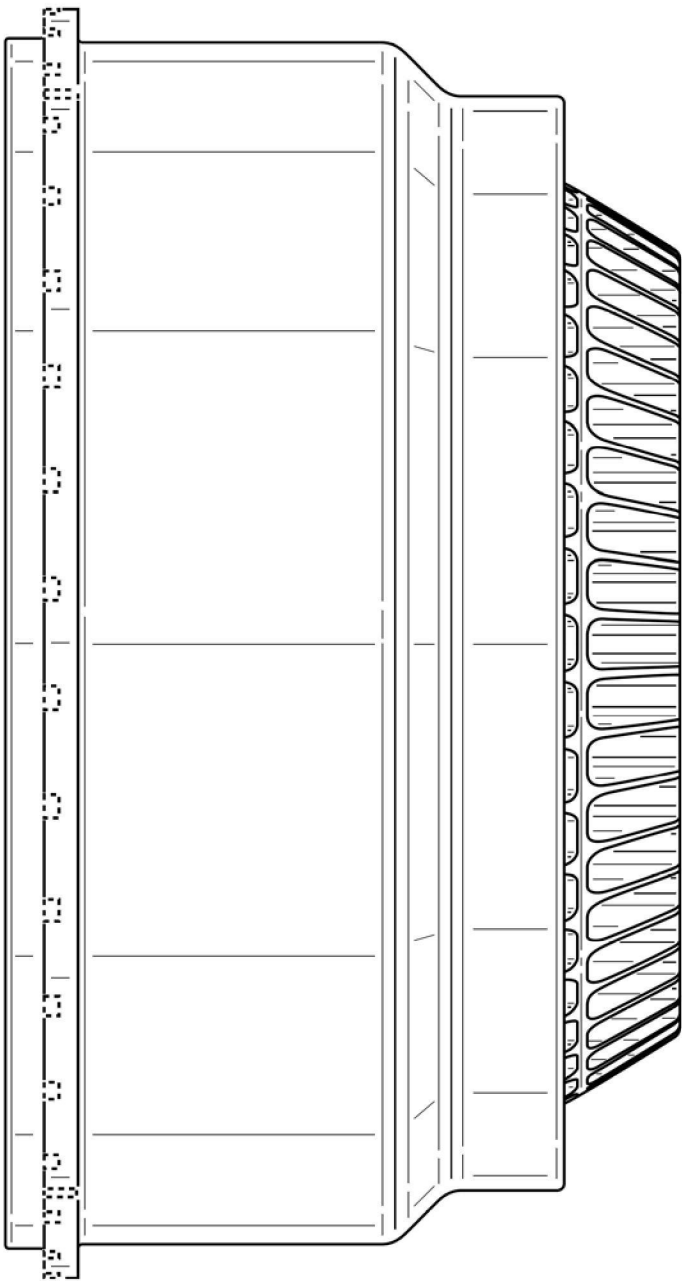
俯視圖

仰視圖

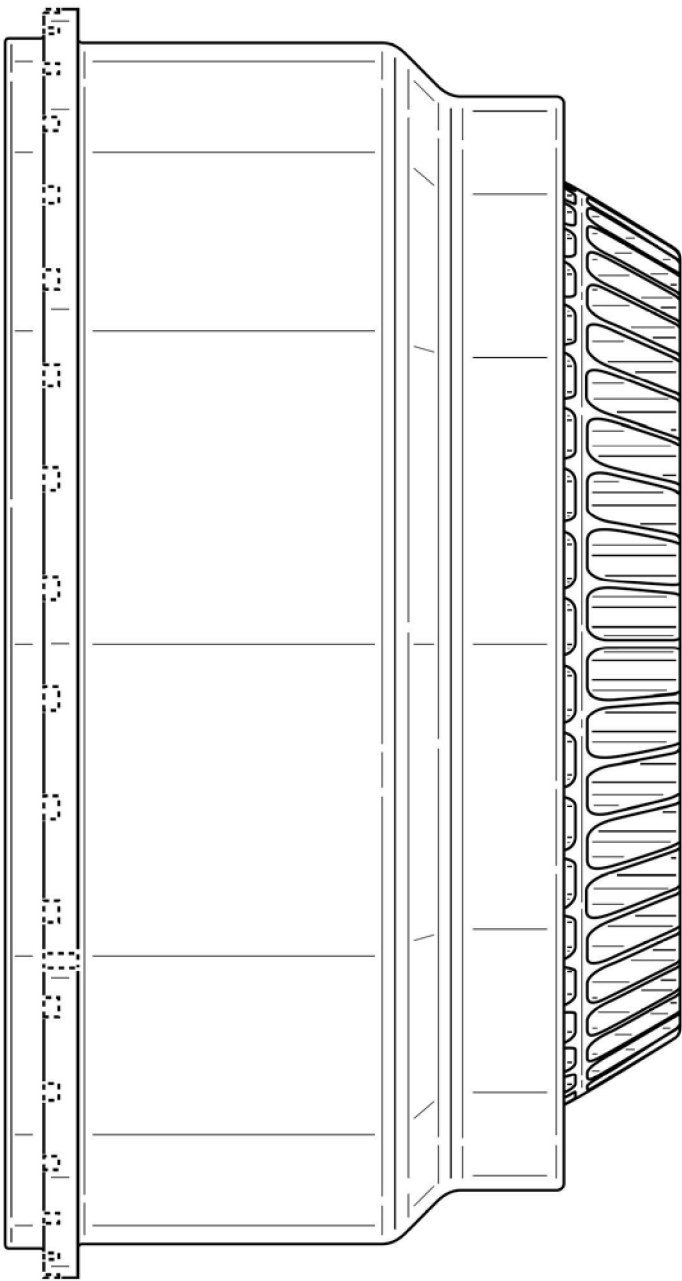




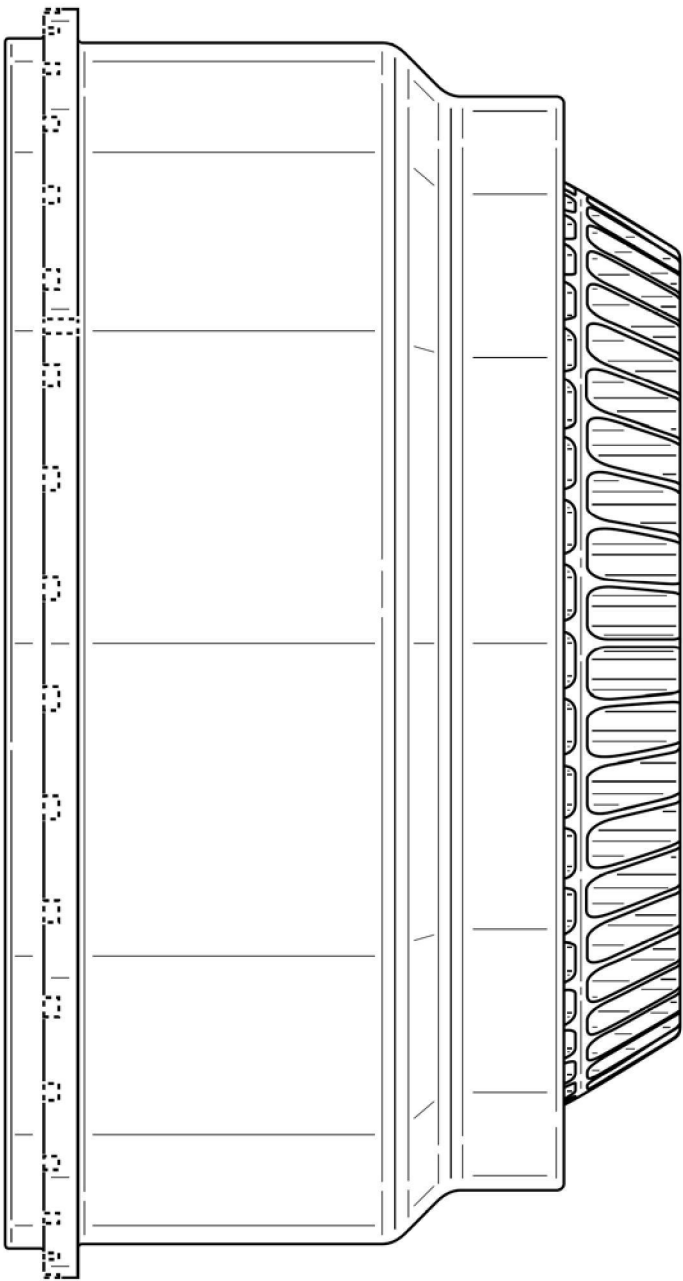
前視圖



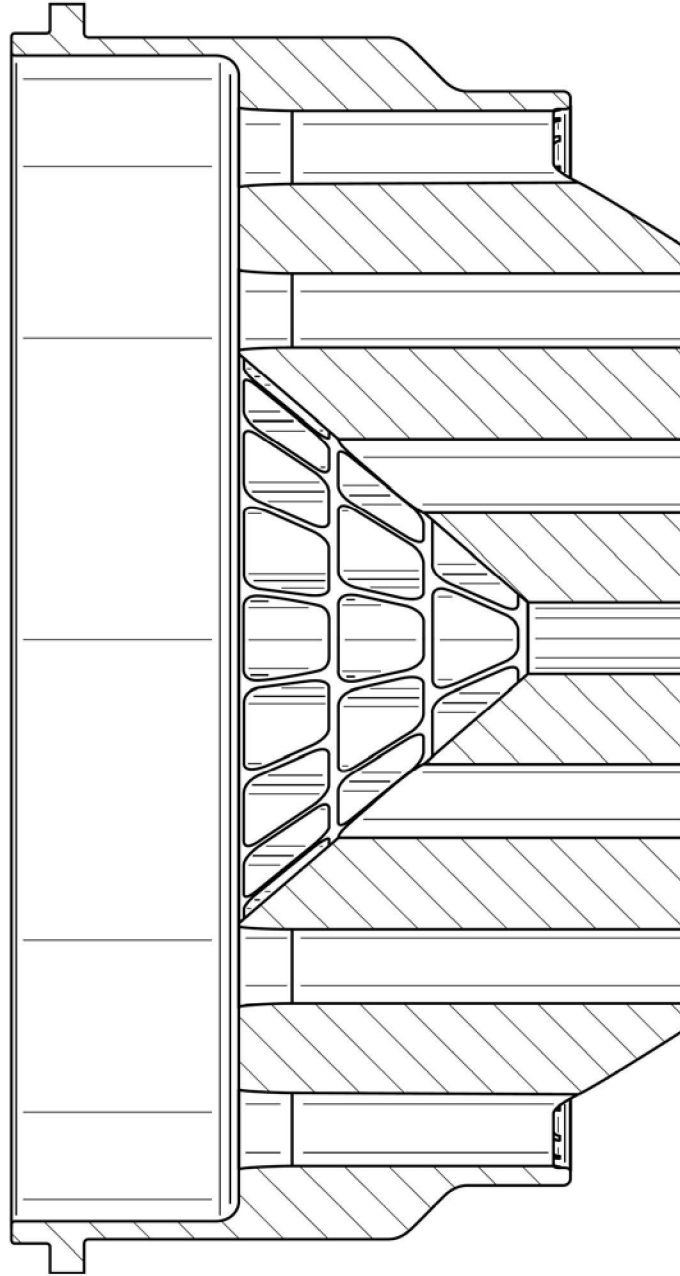
後視圖



左側視圖



右側視圖



沿俯視圖中的線9-9所截的截面圖